(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



558 3*8*2.

(43) 国際公開日 2004 年12 月9 日 (09.12.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/106284 A1

(51) 国際特許分類7:

C07C 253/34, 255/23

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/007653

(22) 国際出願日:

2004年5月27日(27.05.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-154892 2003 年5 月30 日 (30.05.2003)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 東亞合成 株式会社 (TOAGOSEI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒105-8419 東京都港区 西新橋一丁目14番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 加納 宗明 (KANOU,Muneaki) [JP/JP]; 〒455-0027 愛知県 名古 屋市港区船見町1番地の1 東亞合成株式会社内 Aichi (JP). 大橋吉春 (OHASHI,Yoshiharu) [JP/JP]; 〒 455-0027 愛知県名古屋市港区船見町1番地の1 東 亚合成株式会社内 Aichi (JP). (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING PURIFIED 2-CYANOACRYLATE

(54)発明の名称:精製2―シアノアクリレートの製造方法

| (57) Abstract: A method for producing a purified 2-cyanoacrylate is characterized in that distillation is conducted in the presence of a polymerization inhibitor whose boiling point is within ± 12°C of the boiling point of the 2-cyanoacrylate. With this method, polymerization of 2-cyanoacrylate can be continuously prevented in the distillate system during distillation of a crude 2-cyanoacrylate, so that a purified 2-cyanoacrylate can be obtained.

| (57) 要約: 沸点が2-シアノアクリレートの沸点の上下12℃以内にある重合禁止剤の存在下で蒸留することを特徴と

I (57) 要約: 沸点が2-シアノアクリレートの沸点の上下12℃以内にある重合禁止剤の存在下で蒸留することを特徴と する精製2-シアノアクリレートの製造方法である。この方法により、粗製2-シアノアクリレートの蒸留に際して、 留出系における2-シアノアクリレートの重合を継続的に防止して、精製された2-シアノアクリレートを得ることが こできる。



明細書

精製2-シアノアクリレートの製造方法

5 技術分野

本発明は、瞬間接着剤の主成分として広く用いられている精製2ーシアノアクリレートの製造方法に関するものであり、特に製造工程中の精製工程の改良に関するものである。

10 背景技術

15

20

25

2-シアノアクリレートは一般的に、シアノアセテートとホルムアルデヒドとを有機溶媒中で縮合し、得られた重合体を高温減圧下で解重合することによって製造される。ここで得られる粗製2-シアノアクリレートは一般に純度が低く、接着性能、安定性等に劣っているため、更に蒸留することで精製2-シアノアクリレートを得ている。

2-シアノアクリレートの蒸留・精製に関しては、2-シアノアクリレートの 重合を防止するために、五酸化二リン、リン酸、パラトルエンスルホン酸等のア ニオン重合禁止剤と、ハイドロキノン、カテコール、ピロガロール等のラジカル 重合禁止剤とを粗製2-シアノアクリレートに添加し、減圧で加熱蒸留する方法 が知られている。

また、特開平1-135754号公報では、蒸留塔の上部から重合禁止剤を連続的に向流的に添加しながら蒸留する方法が提案されている。

また、米国特許第2794788号公報では、留出系における2-シアノアクリレートの重合防止として SO_2 、BF $_3$ 、HF、 CO_2 等酸性気流下で蒸留を行う方法が開示されている。

さらに、特開平4-124168号公報では、上記のような酸性ガスを用いずに、 BF_3 エーテル錯塩、 BF_3 カルボン酸錯塩のような重合禁止剤を用いて蒸留する方法が提案されている。

発明の開示

15

25

しかし、上記したような五酸化二リンやハイドロキノン等の重合禁止剤、あるいは、BF₃エーテル錯塩、BF₃カルボン酸錯塩等の重合禁止剤を使用しても、 留出系において2-シアノアクリレートが重合しやすい問題はなお残っている。

また、 SO_2 、 BF_3 、HF、 CO_2 等の酸性気流下で蒸留を行う方法は、得られた 2-シアノアクリレートに多量の酸性ガスが含まれることになるため、この酸性ガスを脱気等によって除去する必要がある。また、これら酸性ガスは排ガスとして放出されるため除外設備が必要であり、操作上および環境上の問題がある。

本発明の目的は、上述のような問題を解決すること、すなわち、酸性ガス使用 10 時のような操作上および環境上の問題がなく、2-シアノアクリレートの蒸留に 際して、留出系における2-シアノアクリレートの重合を継続的に防止できる方 法を提供することである。

上記目的を達成するために、本発明者等は、2-シアノアクリレートを蒸留する際の留出系での重合防止方法を鋭意検討した結果、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は、粗製2-シアノアクリレートを重合禁止剤の存在下に蒸留して得る精製2-シアノアクリレートの製造方法において、前記重合禁止剤としてその常圧における沸点が前記精製2-シアノアクリレートの常圧における沸点の上下12℃以内にある重合禁止剤を用いることを特徴とする製造方法、である。

20 発明を実施するための最良の形態

本発明者等は、特開平1-135754号公報で使用されている重合禁止剤は、エチル-2-シアノアクリレートの沸点より上へ12℃を超えて高い沸点を有すること、また、2-シアノアクリレートの沸点より上へ12℃を超えて高い沸点を有する重合禁止剤を用いると、留出系で2-シアノアクリレートの重合が起こりやすいことを発見した。そして、この原因を追求したところ、このような重合禁止剤の使用は目的とする蒸留塔での重合を防止するものの、重合禁止剤が蒸気として2-シアノアクリレートと同伴しないことから留出系にまで行き渡らないためであることも分かった。

また、特開平4-124168号公報で使用されている重合禁止剤は、BF3

エーテル錯塩やBF $_3$ カルボン酸錯塩のように $_2$ ーシアノアクリレートの沸点より下へ $_1$ 2℃を超えて低い沸点を有するか、BF $_3$ フェノール錯塩のように $_2$ ーシアノアクリレートの沸点より上へ $_1$ 2℃を超える高い沸点を有すること、また、 $_2$ ーシアノアクリレートの沸点より下へ $_1$ 2℃を超えて低い沸点を有する重合禁止剤の使用も長時間の蒸留においては蒸留後期に留出系で重合が起こりやすいことを発見した。そして、この原因を追求したところ、このような重合禁止剤は蒸留初期に分離されて系外へ出るためであることも分かった。本発明は、上記知見に基いて完成したものである。

10 以下に、本発明をさらに詳細に説明する。

5

25

本発明における2-シアノアクリレートとしては、メチル-2-シアノアクリレート、エチル-2-シアノアクリレート、プロピル-2-シアノアクリレート、イソプロピル-2-シアノアクリレート、プチル-2-シアノアクリレート、イソプチル-2-シアノアクリレート、アミル-2-シアノアクリレート、ヘキシル-2-シアノアクリレート、シクロヘキシル-2-シアノアクリレート、オクチル-2-シアノアクリレート、2-エチルヘキシル-2-シアノアクリレート、メトキシエチル-2-シアノアクリレート、ベンジル-2-シアノアクリレート、メトキシエチル-2-シアノアクリレート、エトキシエチル-2-シアノアクリレート、メトキシプロピル-2-シアノアクリレート、テトラヒドロフルフリル-2-シアノアクリレート等が挙げられ、これらの2-シアノアクリレートは1種類にとどまらず2種以上を混合使用することもできる。

なお、これらの2-シアノアクリレートの常圧における沸点を例示すれば、メ チルー2-シアノアクリレートは195℃、エチルー2-シアノアクリレートは 200℃、イソプロピルー2-シアノアクリレートは205℃、イソプチルー2-00℃、イソプリレートは2100℃とする。

本発明で使用する重合禁止剤は、常圧における沸点が精製当該2-シアノアクリレートの常圧における沸点の上下12℃以内、好ましくは上下10℃以内にある重合禁止剤である。なお、実際の2-シアノアクリレートの蒸留は減圧下で行

うことが多い。化合物間の沸点差は減圧下では小さくなるが、減圧度により変動するので、本発明では常圧における沸点を基準とする。なお、本発明で使用する重合禁止剤は、上記条件を満足するのであれば、ラジカル重合禁止剤を使うこともできるが、好ましいものはアニオン重合禁止剤である。

- アニオン重合禁止剤(カッコ内数字は常圧基準の沸点)の例は、エチルー2-シアノアクリレート(200℃)に対しては、クロロ酢酸(189℃)、ジクロ - 口酢酸 (194℃)、トリクロロ酢酸 (196℃)、ブロモ酢酸 (206℃)、 ジプロモフルオロ酢酸(198℃)、3-クロロプロピオン酸(203-205 \mathbb{C})、2,2-ジクロロプロピオン酸(210 \mathbb{C})、2-ブロモプロピオン酸(10 203℃)、2-クロロ酪酸(210℃)、4-クロロ酪酸(196℃)、te r t - プチル酢酸 (190℃)、2, 3-ジメチル酪酸 (191-192℃)、 2-エチル酪酸(191-195℃)、2-エチル-2-メチル酪酸(200-202℃)、3-メトキシイソ酪酸(197-201℃)、2-メチル吉草酸(196-197℃)、3-メチル吉草酸(196-198℃)、4-メチル吉草 酸(199-201℃)、2-エチル吉草酸(209℃)、2-メトキシ吉草酸 15 $(193-197^{\circ})$ 、ヘキサン酸 (202°) 、5-ヘキセン酸 (202°) 、 3, 3-ジメチルアクリル酸(<math>194-195°C)、ペンタフルオロプロパンス ルホン酸 (196°)、BF₃メタノール錯体 (200°)、BF₃エタノール錯 体(200℃)等が挙げられる。
- また、プロピルー2ーシアノアクリレート(210℃)に対しては、プロモ酢酸、3ークロロプロピオン酸、2,2ージクロロプロピオン酸、2ープロモプロピオン酸、3ーエトキシプロピオン酸(216℃)、3ーエトキシー2ーメチルプロピオン酸(214-215℃)、2ークロロ酪酸、2ーエチルー2ーメチル酪酸、3ーメトキシイソ酪酸、2ーメトキシメチル酪酸(218-220℃)、2ープロピル吉草酸、2ーエチルー4ーメチル吉草酸(218-220℃)、2ープロピル吉草酸(220℃)、ヘキサン酸、2ーメチルヘキサン酸(209℃)、5ーメチルヘキサン酸(212℃)、5ーヘキセン酸、ノナフルオロブタンスルホン酸(210-212℃)、BF3メタノール錯体、BF3エタノール錯体等が

挙げられる。

また、プチルー2ーシアノアクリレート(230℃)に対しては、3-メチルスルファニルプロピオン酸(235-240℃)、2,2-ジエチル酪酸(220-221℃)、2-メトキシメチル酪酸、2-エトキシメチル酪酸(225-26℃)、3,4-ジメチル吉草酸(220-225℃)、2-エチルー4-メチル吉草酸、2-プロピル吉草酸、5-オキソ吉草酸(240℃)、2,5-ジメチルへキサン酸(228-230℃)、ヘプタン酸(223℃)、3-エチルヘプタン酸(236℃)、オクタン酸(237℃)、シクロヘキサンカルボン酸(232-233℃)、トリクロロアクリル酸(221-223℃)、シアノ酢酸(230℃)、ウンデカフルオロペンタンスルホン酸(223-226℃)、トリデカフルオロヘキサンスルホン酸等が挙げられる。

また、エトキシエチルー2-シアノアクリレート(240℃)に対しては、3-メチルスルファニルプロピオン酸、5-オキソ吉草酸、2,5-ジメチルヘキサン酸、3-エチルヘプタン酸、2-メトキシヘプタン酸(246-250℃)、オクタン酸、2-メチルオクタン酸(244-246℃)、シクロヘキサンカルボン酸、シアノ酢酸等が挙げられる。

10

15

20

25

これらの重合禁止剤の中では、酸性度が高いものが低濃度で速効性があるため、ハロゲン化カルボン酸類またはハロゲン化スルホン酸類が好ましい。具体的には、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、プロモ酢酸、ジブロモフルオロ酢酸、3ークロロプロピオン酸、2,2ージクロロプロピオン酸、2ーブロモプロピオン酸、2ークロロ酪酸、4ークロロ酪酸、ペンタフルオロプロパンスルホン酸、ノナフルオロブタンスルホン酸、トリクロロアクリル酸、ウンデカフルオロペンタンスルホン酸、トリデカフルオロヘキサンスルホン酸、3ーメチルスルファニルプロピオン酸が挙げられる。更に2ーシアノアクリレートとの沸点の関係が合えば、ジクロロ酢酸およびトリクロロ酢酸が特に好ましい。また、ハロゲン化カルボン酸類またはハロゲン化スルホン酸類以外には、BF3メタノール錯体、BF。エタノール錯体も好ましい。

これら沸点については、Aldrich等のカタログ記載又は「CrossFire Beilstein」という化学データベースから検索できる。

5

本発明で用いる粗製 2 ーシアノアクリレートは、通常の方法、例えばシアノ酢酸エステルとホルムアルデヒドを有機溶媒中、塩基触媒の存在下で加熱して縮合し、得られた縮合体を解重合触媒、重合抑制剤の存在下、減圧高温下で解重合することによって得られる粗製 2 ーシアノアクリレートが一般的に使用できる。

蒸留方法としては、例えば充填式蒸留塔や棚段式蒸留塔を用いて上記の方法で 5 製造された粗製2-シアノアクリレートを減圧下で加熱する方法が挙げられる。 このとき、蒸留圧力は好ましくは1~10mmHgとし、蒸留温度は好ましくは 50~100℃とする。また、この際、釜側にある粗製2-シアノアクリレート に、五酸化二リン、パラトルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、プロパンサル トン等のアニオン重合禁止剤か、ハイドロキノン、tープチルカテコール、ピロ 10 ガロール等のラジカル重合禁止剤を添加するのが好ましく、更に好ましくはその 両方を添加する。これら重合禁止剤は、釜液の安定化のために添加するのである から、対象となる2−シアノアクリレートの沸点より上へ12℃を超える高い沸 点を有するものが好ましい。また、上記2-シアノアクリレートの沸点より上へ 12℃を超える高い沸点を有するアニオン重合禁止剤及びラジカル重合禁止剤の 15 添加量は、2 - シアノアクリレート(100重量部)に対して、いずれの重合禁 止剤も各々0.05~1.0重量部とすることが好ましい。

沸点が2・シアノアクリレートの沸点の上下12℃以内、好ましくは10℃以
 内にある重合禁止剤の添加方法としては、釜中の粗製2ーシアノアクリレートに
 予め添加するか、または精製2ーシアノアクリレートに溶解して蒸留釜もしくは
 蒸留塔上部より連続的に添加してもよい。好ましくは、重合禁止剤を釜に添加し、
 かつ蒸留塔上部より連続的に添加する。

前記重合禁止剤の添加量は、粗製又は精製2-シアノアクリレートに対して1~1000重量ppmが好ましく、より好ましくは10~100重量ppmである。重合禁止剤が上記の範囲にあれば、重合禁止剤としての効果が十分であり、留出系内で重合を起こす恐れがなく、また、得られた留分の接着速度を本来の速度に維持できる。

25

蒸留後の精製された2-シアノアクリレートには、保存のために、SO。、パラ

トルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、プロパンサルトン、BF₃錯体等のアニオン重合禁止剤や、ハイドロキノン、 t ープチルカテコール、ピロガロール等のラジカル重合禁止剤を任意の量添加することが好ましい。

2-シアノアクリレートの蒸留において、2-シアノアクリレートと沸点が近い重合禁止剤を用いると、蒸留系での重合が防止できる理由は、この重合禁止剤は2-シアノアクリレートの蒸気と同伴することによって蒸留塔から留出系にかけて万遍なく行き渡ることから、蒸留装置全体を長時間に渡って重合防止することができるためと推測される。

10 実施例

以下、実施例および比較例により、さらに詳しく本発明を説明するが、本発明 はこれらに限定されるものではない。評価の方法は、蒸留留出系での重合物の有 無を目視で確認した。

実施例1~6、比較例1~4

15 粗製エチルー2ーシアノアクリレートに対して、ハイドロキノン(0.5重量%)および五酸化二リン(0.1重量%)をそれぞれ釜液安定剤として添加し、重合禁止剤として表1に示す化合物の精製エチルー2ーシアノアクリレート溶液(濃度は表1のとおり)を充填塔上部から連続的にスプレーしながら、理論段数10段の充填式蒸留塔を用いて5mmHgの減圧下、釜温度70~80℃で1時20 間還流操作をした後に還流比3で蒸留を行った。そして初留分10%を留去させた後、留分60~70%の精製エチルー2ーシアノアクリレートを得た。蒸留留出系での重合の有無について表1に示した。

実施例7

粗製メチルー2-シアノアクリレートに対して、ハイドロキノン(0.5重量 25 %)および五酸化二リン(0.1重量%)をそれぞれ釜液安定剤として添加し、 重合禁止剤として表1に示す化合物の精製メチルー2-シアノアクリレート溶液 (濃度は表1のとおり)を充填塔上部から連続的にスプレーしながら、他は実施 例1と同様の方法で蒸留を行い、精製メチルー2-シアノアクリレートを得た。 蒸留出系での重合の有無について表1に示した。

実施例8

粗製イソプロピルー2ーシアノアクリレートに対して、ハイドロキノン(0.5重量%)および五酸化二リン(0.1重量%)をそれぞれ釜液安定剤として添加し、重合禁止剤として表1に示す化合物の精製イソプロピルー2ーシアノアクリレート溶液(濃度は表1のとおり)を充填塔上部から連続的にスプレーしながら、釜温度を80~90℃にする他は実施例1と同様の方法で蒸留を行い、精製イソプロピルー2ーシアノアクリレートを得た。蒸留留出系での重合の有無について表1に示した。

実施例9

10 粗製イソブチルー2ーシアノアクリレートに対して、ハイドロキノン(0.5 重量%)および五酸化二リン(0.1重量%)をそれぞれ釜液安定剤として添加し、重合禁止剤として表1に示す化合物の精製イソプチルー2ーシアノアクリレート溶液(濃度は表1のとおり)を充填塔上部から連続的にスプレーしながら、釜温度を80~90℃にする他は実施例1と同様の方法で蒸留を行い、精製イソプチルー2ーシアノアクリレートを得た。蒸留留出系での重合の有無について表1に示した。

表1

	2ーシアノアクリレート		重合禁止	留出系の		
	種類	沸点(℃)	種類	沸点(℃)	添加量*	重合物
実施例1	エチル	200	ジクロロ酢酸	194	50	無し
実施例2	エチル	200	ジクロロ酢酸	194	10	無し
実施例3	エチル	200	ジクロロ酢酸	194	100	無し
実施例4	エチル	200	トリクロロ酢酸	196	10	無し
実施例5	エチル	200	ヘキサン酸	202	100	無し
実施例6	エチル	200	BF ₃ メタノール錯体	200	50	無し
実施例7	メチル	195	ジクロロ酢酸	194	50	無し
実施例8	イソプロピル	205	BF ₃ メタノール錯体	200	50	無し
実施例9	イソブチル	210	ブロモ酢酸	206	100	無し
比較例1	エチル	200	パラトルエンスルホン酸	260	50	有り(大)
比較例2	エチル	200	4-メチルヘキサン酸	221	100	有り(大)
比較例3	エチル	200	BF ₃ ジエチルエーテル錯体	126	50	有り(大)
比較例4	エチル	200	BF ₃ 酢酸錯体	180	50	有り(小)

*:ppm

表1から明らかなように、本発明による重合禁止剤を用いずに2-シアノアク 20 リレートの沸点よりも上へ12℃を超えて高い沸点を有する重合禁止剤を添加し

た場合(比較例 1)、および2-シアノアクリレートの沸点より下へ12℃を超えて低い沸点を有する重合禁止剤を添加した場合(比較例 2)においては、蒸留中に留出系で重合物の付着が見られた。これに対して本発明による方法で重合禁止剤を連続添加した場合(実施例 $1\sim 9$)においては留出系で重合物の付着が見られなかった。

産業上の利用可能性

5

請求の範囲

- 1. 粗製2-シアノアクリレートを重合禁止剤の存在下に蒸留して得る精製2 -シアノアクリレートの製造方法において、前記重合禁止剤としてその常 圧における沸点が前記精製2-シアノアクリレートの常圧における沸点の 上下12℃以内にある重合禁止剤を用いることを特徴とする製造方法。
- 2. 重合禁止剤がアニオン重合禁止剤である請求項1記載の製造方法。

5

- 3. アニオン重合禁止剤がハロゲン化カルボン酸またはハロゲン化スルホン酸 類である請求項2記載の製造方法。
- 4. ハロゲン化カルボン酸またはハロゲン化スルホン酸類が、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、プロモ酢酸、ジプロモフルオロ酢酸、3-クロロプロピオン酸、2,2-ジクロロプロピオン酸、2ープロモプロピオン酸、2ープロロックロロックリルオロプロパンスルホン酸、1ナフルオロブタンスルホン酸、トリクロロアクリル酸、ウンデカフルオロペンタンスルホン酸、トリデカフルオロペキサンスルホン酸または3-メチルスルファニルプロピオン酸である請求項3記載の製造方法。
 - 5. アニオン重合禁止剤が、 BF_3 メタノール錯体または BF_3 エタノール錯体である請求項2記載の製造方法。
 - 重合禁止剤を、釜に予め添加しておく、請求項1記載の製造方法。
- 20 7. 重合禁止剤を、精製2-シアノアクリレートに溶解して蒸留釜上部もしく は蒸留塔上部から連続的に添加する請求項1記載の製造方法。
 - 8. 重合禁止剤を、粗製2-シアノアクリレートに対して1~1000重量p pm添加する請求項6記載の製造方法。
- 9. 重合禁止剤を、精製2-シアノアクリレートに対して1~1000重量p pm添加する請求項7記載の製造方法。
 - 10. 粗製2-シアノアクリレートとして、シアノ酢酸エステルとホルムアルデヒドを有機溶媒中、塩基触媒の存在下で加熱して縮合し、得られた縮合体を解重合触媒、重合抑制剤の存在下、減圧高温下で解重合することによって得られる粗製2-シアノアクリレートを用いる請求項1乃至9のいずれ

か一つに記載の製造方法。

11. 蒸留は、充填式蒸留塔を用いて減圧下で加熱する方法である請求項1乃至9のいずれか一つに記載の製造方法。

- 12. 蒸留は、釜側にある2-シアノアクリレートに、2-シアノアクリレート
 の沸点より上に12℃を超えて高い沸点を有するアニオン重合禁止剤とラジカル重合禁止剤とを更に添加して行う請求項1乃至9のいずれか一つに記載の製造方法。
 - 13. アニオン重合禁止剤は五酸化リンであり、ラジカル重合禁止剤はハイドロキノンである、請求項12記載の製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP2004/007653

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl⁷ C07C253/34, 255/23

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) ${\tt Int.Cl}^7$ C07C253/34, 255/23

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 4-124168 A (Taoka Chemical Co., Ltd.), 24 April, 1992 (24.04.92), Claims; page 2, upper left column to upper right column	1-13
Y	JP 48-85531 A (Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha), 13 November, 1973 (13.11.73), Claims	1-13
Y	JP 46-37278 B1 (Eastman Kodak Co.), 02 November, 1971 (02.11.71), Claims; column 11	1-13

$ \times $	Further documents are listed in the continuation of Box C.	×	See patent family annex.	
* "A"	Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T"	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention	
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date		"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone		
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or cited to establish the publication date of another citation special reason (as specified)	cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination	
"P"	cument referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means cument published prior to the international filing date but later than a priority date claimed	"&"	being obvious to a person skilled in the art	
	of the actual completion of the international search 03 August, 2004 (03.08.04)	Dat	e of mailing of the international search report 24 August, 2004 (24.08.04)	
	e and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Aut	horized officer	
Facs	imile No.	Tele	ephone No.	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/007653

	POOLE TEMPO CONSIDERED TO BE BELLEVIANT		704.7007655
C (Continuation)	DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevan		Relevant to claim No.
Y	JP 49-31619 A (Taoka Chemical Co., Ltd.), 22 March, 1974 (22.03.74), Claims		1-13
Y .	JP 10-182580 A (Toagosei Co., Ltd.), 07 July, 1998 (07.07.98), Par. No. [0027]	·	1–13
			;
,			
·			
	,		

INTERNATIONAL SEARCE Information on patent family r	International application No. PCT/JP2004/007653			
JP 4-124168 A	1992.04.24	(Family: none)		
JP 48-85531 A	1973.11.13	DE 2307834 A FR 2172406 A GB 1392400 A		
JP 46-37278 B1	1971.11.02	(Family: none)		
JP 49-31619 A	1974.03.22	(Family: none)		
JP 10-182580 A	1998.07.07	(Family: none)		

国際調査報告

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. C1. C07C253/34, 255/23

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. C07C253/34, 255/23

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C.	関連	す	る	ح	認め	6	れ	る	猫文	

C. 関連する	C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
Y	JP 4-124168 A(田岡化学工業株式会社)1992.04.24 特許請求の範囲,第2頁左上欄-右上欄	1–13	
Y	JP 48-85531 A (電気化学工業株式会社) 1973.11.13 特許請求の範囲	1–13	
Y	JP 46-37278 B1 (イーストマン・コダック・カンパニー) 1971.11.02 特許請求の範囲,第11欄	1-13	

|X| パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査報告の発送日 国際調査を完了した日 03.08.2004 24. 8, 2004 特許庁審査官(権限のある職員) 4 H 9547 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 爾見 武志 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3443

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
Y	JP 49-31619 A(田岡化学工業株式会社)1974.03.22 特許請求の範囲	1-13
Y	JP 10-182580 A (東亞合成株式会社) 1998.07.07 [0027]	1–13
	1	

国際調査報告 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号 PCT/JP2004/007653

JP 4-124168 A	1992. 04. 24	ファミリーなし
JP 48-85531 A	1973. 11. 13	DE 2307834 A FR 2172406 A GB 1392400 A
JP 46-37278 B1	1971. 11. 02	ファミリーなし
JP 49-31619 A	1974. 03. 22	ファミリーなし
JP 10-182580 A	1998. 07. 07	ファミリーなし
ſ		